Rec's PETATO 1 9 MAY 20054

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

10/535448

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



TER 1818 BEHEEF DE DE BEEFE DE BEEFE KOEFE HEEFE HEEFE HEEFE HEEFE HEEFE HEEFE HEEFE BEEFE BEEFE BEHEEFE

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 3. Juni 2004 (03.06.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/047144 A2

(51) Internationale Patentklassifikation7:

H01L

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE2003/003770

(22) Internationales Anmeldedatum:

13. November 2003 (13.11.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 53 953.7

19. November 2002 (19.11.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): CLEMENS, Wolfgang [DE/DE]; Kornstr. 5, 90617 Puschendorf (DE). FIX,

Walter [DE/DE]; Rötenäckerstr. 7, 90427 Nürnberg (DE). ULLMANN, Andreas [DE/DE]; Kornstädter Str. 16 A, 90765 Fürth (DE).

(74) Anwalt: LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ; Postfach 3055, 90014 Nürnberg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Veröffentlicht:

 ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ORGANIC ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING A STRUCTURED, SEMI-CONDUCTIVE FUNCTIONAL LAYER AND A METHOD FOR PRODUCING SAID COMPONENT

(54) Bezeichnung: ORGANISCHES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT STUKTURIERTER HALBLEITENDER FUNKTIONSSCHICHT UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAZU

(57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component such as an organic field-effect transistor and a method for producing said component. According to the invention, the semi-conductive layer of the component is structured, although said component can be produced by a cost-effective printing process. To achieve this, the lower functional layer is prepared by a treatment, in such a way that it comprises sub-sections, which are exposed to wetting in a subsequent process step and sub-sections that are not exposed to wetting.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor und ein Herstellungsverfahren dazu, wobei die halbleitende Schicht des Bauelements strukturiert ist, obwohl das Bauelement im preisgünstigen Druckverfahren herstellbar ist. Um dies zu erreichen wird die untere Funktionsschicht durch eine Behandlung so präpariert, dass sie Teilbereiche hat, auf denen im nachfolgenden Prozessschritt Benetzung stattfindet und Teilbereiche, auf denen keine Benetzung erfolgt.



Beschreibung

5

10

15

20

25

30

35

Organisches elektronisches Bauelement mit strukturierter halbleitender Funktionsschicht und Herstellungsverfahren dazu

Die Erfindung betrifft ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor und ein Herstellungsverfahren dazu, wobei die halbleitende Schicht des Bauelements strukturiert ist.

Bei organischen elektronischen Bauelementen werden die organischen halbleitenden Funktionsschichten üblicherweise großflächig durch Spin-coating, Aufsprühen, Rakeln oder ähnliches als homogene großflächige aber sehr dünne Funktionsschichten aufgebracht.

Bei einer integrierten Schaltung kann das zu Problemen führen, da Leckströme von einem Bauelement oder von einer Elektrode zur nächsten entstehen, wenn die halbleitenden Funktionsschichten der Bauelemente aneinander stoßen. Diese Leckströme stören die Performance der Schaltung zum Teil erheblich. Deshalb werden Versuche unternommen, die halbleitenden Funktionsschichten zu strukturieren und/oder sie auf die aktiven Flächen, also die Bereiche wo sich Stromkanäle ausbilden, zu reduzieren. Diese Strukturierung kann bei photolithographisch hergestellten Bauelementen durch entsprechende Belichtungsmasken erreicht werden. Für eine breite Anwendung werden aber photolithographisch hergestellte Bauelemente zu teuer. Deshalb wird bei der Entwicklung der Elemente auf preisgünstige Druckherstellungsmethoden fokussiert.

Die halbleitende Funktionsschicht kann jedoch nicht durch herkömmliche Druckmethoden strukturiert aufgebracht werden, weil diese Schicht sehr dünn sein muss (typischerweise kleiner 100nm), damit sie funktioniert. Die beispielsweise für die halbleitende Funktionsschicht geforderten Schichtdicken

15

20

30

35

sind herkömmlicherweise nur über Belackung wie Coating, Aufsprühen etc. zu erreichen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, bei gedruckt hergestellten organischen elektronischen Bauelementen eine 5 Strukturierung einer dünnen, insbesondere der halbleitenden Funktionsschicht zu ermöglichen, ohne dass dabei die Schichtdicke der betroffenen Funktionsschicht gegenüber einer normalerweise durch Belackung (Coating, Aufsprühen, Einrakeln) hergestellten, z.B. halbleitenden, Funktionsschicht gesteigert wird.

Gegenstand der Erfindung ist ein organisches elektronisches Bauelement mit einer strukturierten halbleitenden Funktionsschicht einer Dicke kleiner 100nm, wobei die Strukturierung dadurch entsteht, dass eine untere Funktionsschicht nur partiell mit dem organischen Funktionsmaterial der nächsten Funktionsschicht benetzt wird. Außerdem ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines organischen elektronischen Bauelements, bei dem durch gezielte Behandlung einer unteren Funktionsschicht eine obere Funktionsschicht trotz großflächiger Auftragung strukturiert erzeugt wird.

Nach einer Ausführungsform des Verfahrens wird eine halbleitende Schicht strukturiert erzeugt. 25

Nach einem Ausführungsbeispiel wird die untere Funktionsschicht durch einen Lack partiell abgedeckt, der durch Drucken in ganz geringer Schichtdicke aufbringbar ist.

Als obere, strukturierte Funktionsschichten können durch das Verfahren halbleitende, isolierende, und/oder leitende organische Funktionsschichten, aber natürlich auch anorganische Funktionsschichten, wie z.B. dünne Metallschichten strukturiert hergestellt werden.

Die untere Funktionsschicht ist je nach Aufbau des organischen elektronischen Bauelements und der oberen Schicht das Substrat, eine leitende Funktionsschicht etc.

Als "gezielte Behandlung" wird die partielle Abdeckung 5 und/oder die lokale Veränderung der unteren Funktionsschicht bezeichnet, die bewirkt, dass in ausgewählten Bereichen der unteren Funktionsschicht beim Belacken mit dem Material Benetzung stattfindet oder vermieden wird (also "partielle Benetzung" stattfindet), kann mittels einer Druckmethode, durch 10 Laserbehandlung, Wärmebehandlung, andere physikalische, elektrische oder chemische Behandlung, immer jedoch partiell und mit einer Auflösung im µm-Bereich, erfolgen. Beispielhaft genannt sei die partielle Kontaktierung mit Säure/Base oder anderen reaktiven chemischen Substanzen, physikalische Effek-15 te wie Licht, Wärme, Kälte und schließlich die mechanische Behandlung wie Reiben. Die Folge der Behandlung ist in jedem Falle die, dass die nächste Funktionsschicht auf den behandelten Stellen nicht oder nur dort benetzt.

20

Der Begriff "organisches Material" und/oder "Funktionspolymer" umfasst hier alle Arten von organischen, metallorganischen und/oder anorganischen Kunststoffen, die im Englischen z.B. mit "plastics" bezeichnet werden. Es handelt sich um alle Arten von Stoffen mit Ausnahme der Halbleiter, die die klassischen Dioden bilden (Germanium, Silizium), und der typischen metallischen Leiter. Eine Beschränkung im dogmatischen Sinn auf organisches Material als Kohlenstoff enthaltendes Material ist demnach nicht vorgesehen, vielmehr ist auch an den breiten Einsatz von z.B. Siliconen gedacht. Weiterhin soll der Term keiner Beschränkung im Hinblick auf die Molekülgröße, insbesondere auf polymere und/oder oligomere Materialien unterliegen, sondern es ist durchaus auch der Einsatz von "small molecules" möglich.

Im folgenden wird die Erfindung noch anhand zweier Figuren, die eine Draufsicht und einen Querschnitt durch ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen organischen elektronischen Bauteils zeigen:

5

10

15

35

Figur 1 zeigt eine Aufsicht auf eine Schaltung mit einer strukturierten halbleitenden Funktionsschicht. Zu sehen ist eine organische Schaltung, die auf einem Substrat (verdeckt) aufgebaut ist. Es sind mehrere aktive Elemente wie organische Feld-Effekt-Transistoren nebeneinander angeordnet, zu erkennen sind jeweils die Source/Drain Elektroden 2. Der schraffierte Bereich zeigt die organische Halbleiterschicht 1, die strukturiert ist und Teilbereiche 3 hat, die frei von halbleitendem Funktionsmaterial sind. Durch den freien Bereich 3 ("frei" heißt hier weder mit leitendem noch mit halbleitendem Material bedeckt) wird ein Leckstrom vom linken in den rechten Bereich der Schaltung unterdrückt.

Figur 2 zeigt einen OFET mit dem Substrat 4 und den Source/Drain Elektroden 2. Auf der leitenden Funktionsschicht,
den Source/Drain Elektroden 2 befindet sich die strukturierte
halbleitende Funktionsschicht 1, die sich nicht ganzflächig
über die leitende Funktionsschicht 2 erstreckt, sondern die
durch den Lack 6, der das Substrat 4 partiell gegen die Benetzung mit halbleitender Funktionsschicht 1 abdeckt, unterbrochen, also strukturiert nur die aktiven Flächen, das heißt
die Flächen oberhalb der Source/Drain Elektroden, bedeckt.
Die halbleitende Funktionsschicht ihrerseits wird durch die
isolierende Funktionsschicht 5 bedeckt, auf der sich die Gate-Elektroden 7 befinden.

Die Erfindung betrifft ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor und ein Herstellungsverfahren dazu, wobei eine dünne Schicht, wie die halbleitende Schicht des Bauelements strukturiert ist, obwohl das Bauelement im preisgünstigen Druckverfahren herstellbar ist. Um dies zu erreichen wird die untere Funktionsschicht

durch eine Behandlung so präpariert, dass sie Teilbereiche hat, auf denen im nachfolgenden Prozessschritt Benetzung stattfindet und Teilbereiche, auf denen keine Benetzung erfolgt.

Patentansprüche

- 1. Organisches elektronisches Bauelement mit einer strukturierten Funktionsschicht einer Dicke kleiner 100nm, wobei die Strukturierung dadurch entsteht, dass eine untere Funktionsschicht nur partiell mit dem organischen Funktionsmaterial der nächsten Funktionsschicht benetzt wird.
- 2. Organisches elektronisches Bauelement nach Anspruch 1, bei 10 dem die strukturierte Funktionsschicht eine halbleitende Funktionsschicht ist.
- 3. Verfahren zur Herstellung eines organischen elektronischen Bauelements, bei dem durch gezielte Behandlung einer unteren Funktionsschicht eine obere Funktionsschicht trotz großflächiger Auftragung strukturiert erzeugt wird.
 - 4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem eine halbleitende Funktionsschicht strukturiert erzeugt wird.
 - 5. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem die untere Funktionsschicht durch einen Lack partiell abgedeckt wird, der durch Drucken in ganz geringer Schichtdicke aufbringbar ist.

20

FIG 1

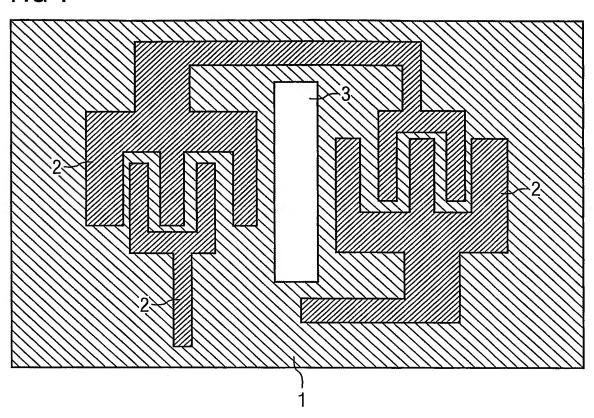
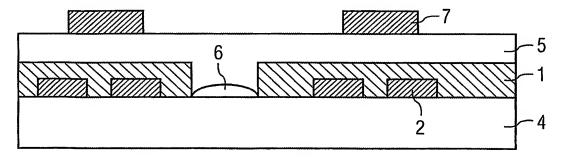


FIG 2



(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



10/535448

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 3. Juni 2004 (03.06.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/047144 A3

(51) Internationale Patentklassifikation7:

H01L 51/20

PCT/DE2003/003770

ULLMANN, Andreas [DE/DE]; Kornstädter Str. 16 A, 90765 Fürth (DE).

(74) Anwalt: LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ; Postfach 3055,

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

- (21) Internationales Aktenzeichen:
- (22) Internationales Anmeldedatum:

13. November 2003 (13.11.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 53 953.7

19. November 2002 (19.11.2002) D

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.

90014 Nürnberg (DE).

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): CLEMENS, Wolfgang [DE/DE]; Kornstr. 5, 90617 Puschendorf (DE). FIX, Walter [DE/DE]; Rötenäckerstr. 7, 90427 Nürnberg (DE).

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
Recherchenberichts: 2. September 2004

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ORGANIC ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING A STRUCTURED, SEMI-CONDUCTIVE FUNCTIONAL LAYER AND A METHOD FOR PRODUCING SAID COMPONENT

(54) Bezeichnung: ORGANISCHES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT STUKTURIERTER HALBLEITENDER FUNKTIONSSCHICHT UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAZU

(57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component such as an organic field-effect transistor and a method for producing said component. According to the invention, the semi-conductive layer of the component is structured, although said component can be produced by a cost-effective printing process. To achieve this, the lower functional layer is prepared by a treatment, in such a way that it comprises sub-sections, which are exposed to wetting in a subsequent process step and sub-sections that are not exposed to wetting.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor und ein Herstellungsverfahren dazu, wobei die halbleitende Schicht des Bauelements strukturiert ist, obwohl das Bauelement im preisgünstigen Druckverfahren herstellbar ist. Um dies zu erreichen wird die untere Funktionsschicht durch eine Behandlung so präpariert, dass sie Teilbereiche hat, auf denen im nachfolgenden Prozessschritt Benetzung stattfindet und Teilbereiche, auf denen keine Benetzung erfolgt.



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01L51/20						
•		· ·				
	o international Patent Classification (IPC) or to both national classification	ication and IPC				
B. FIELDS	SEARCHED ocumentation searched (classification system followed by classification system followed by classif	ation symbols)				
IPC 7	H01L					
Documentat	tion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fields se	earched			
Electronic d	lata base consulted during the international search (name of data t	pase and, where practical, search terms used)			
EPO-In	ternal, CHEM ABS Data, PAJ, WPI Dat	a				
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.			
х	DE 199 18 193 A (CAMBRIDGE DISPLAY TECH) 25 November 1999 (1999-11-25) column 3, line 10 - line 25 column 9, line 47 - line 62 the whole document					
Х	WO 99/54936 A (SIRRINGHAUS HENN TESSLER NIR (GB); CAMBRIDGE DISI (GB); F) 28 October 1999 (1999- page 6 the whole document	1–5				
P,X	US 2003/059987 A1 (SIRRINGHAUS AL) 27 March 2003 (2003-03-27) paragraph '0101! the whole document	HENNING ET	1–5			
Furi	ther documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.			
Special categories of cited documents:						
	nent defining the general state of the art which is not idered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict will cited to understand the principle or the invention	h the application but			
E earlier document but published on or after the international "X* document of particular relevance; the claimed investigation in the control of particular relevance; the claimed investigation in the control of particular relevance; the claimed investigation in the control of particular relevance; the claimed investigation in the control of particular relevance; the claimed investigation in the control of particular relevance; the claimed investigation in the control of particular relevance; the claimed investigation in the control of particular relevance; the claimed investigation in the control of particular relevance; the claimed investigation in the control of particular relevance; the claimed investigation in the control of particular relevance; the claimed investigation in the control of particular relevance; the claimed investigation in the control of particular relevance; the claimed investigation in the control of particular relevance in the control of particular re						
"L" docum	eent which may throw doubts on priority claim(s) or n is clied to establish the publication date of another	cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the d	ocument is taken alone			
citation or other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive step when the document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such docu-						
other	means means to the international filing date but	ments, such combination being obvious in the art.				
	than the priority date claimed actual completion of the international search	*&* document member of the same patent family Date of mailing of the international search report				
	17 May 2004	27/05/2004				
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2	Authorized officer				
}	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax (+31-70) 340-2016	Bader, K				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ation on patent family members

Internal	Application No	
PCT.	03/03770	

Pa	atent document I in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE	19918193	A	25-11-1999	DE	19918193 A1	25-11-1999
				GB	2336553 A ,B	27-10-1999
				JP	2000202357 A	25-07-2000
WO	9954936	A	28-10-1999	AU	766162 B2	09-10-2003
				ΑU	3614399 A	08-11-1999
				BR	9909580 A	19-12-2000
				CA	2328094 A1	28-10-1999
				CN	1301400 T	27-06-2001
				ΕP	1074048 A1	07-02-2001
				MO	9954936 A1	28-10-1999
				JP	2002512451 T	23-04-2002
				TW	498395 B 6603139 B1	11-08-2002 05-08-2003
	کیا اساز جداسا کہ کہا ہے سے سازھے سے		ہے سے بطائب کے بہت کا تا ہیں کے سے کے کا کا می	US	000313A DI	U3-U0-2UU3
บร	2003059987	A1	27-03-2003	AU	2015901 A	03-07-2001
				AU	2016001 A	03-07-2001
				AU	2206601 A	03-07-2001
				AU	2206901 A	03-07-2001
				BR	0016643 A	07-01-2003
				BR BR	0016660 A 0016661 A	25-02-2003 25-02-2003
				BR	0016670 A	24-06-2003
				CA	2394881 A1	28-06-2001
				CA	2394886 A1	28-06-2001
				CA	2394895 A1	28-06-2001
				CA	2395004 A1	28-06-2001
				CN	1425201 T	18-06-2003
				CN	1425202 T	18-06-2003
				CN	1425203 T	18-06-2003
				CN	1425204 T	18-06-2003
				EP	1243032 A2	25-09-2002
				EP	1243033 A1	25-09-2002
				EP	1243034 A1	25-09-2002
				EP	1243035 A2	25-09-2002
				MO	0147043 A1	28-06-2001 28-06-2001
				MO	0146987 A2 0147044 A2	28-06-2001 28-06-2001
				WO WO	0147044 AZ 0147045 A1	28-06-2001
				JP	2003518332 T	03-06-2003
				JP	2003518352 T 2003518754 T	10-06-2003
				JP	2003518755 T	10-06-2003
				ĴΡ	2003518756 T	10-06-2003
				ŭs	2003059984 A1	27-03-2003
				ÜS	2003059975 A1	27-03-2003
				US	2003060038 A1	27-03-2003
				TW	552668 B	11-09-2003

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L51/20							
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK							
B. RECHER	CHIERTE GEBIETE						
Recherchiert IPK 7	Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H01L						
Recherchiert	e aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	eit diese unter die recherchierten Gebiete f	allen				
Während der	internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Nar	me der Datenbank und evtl. verwendete S	uchbegriffe)				
EPO-Int	ternal, CHEM ABS Data, PAJ, WPI Data						
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN						
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.				
X	DE 199 18 193 A (CAMBRIDGE DISPLAY 25. November 1999 (1999-11-25) Spalte 3, Zeile 10 - Zeile 25 Spalte 9, Zeile 47 - Zeile 62	1-5					
	das ganze Dokument						
X	WO 99/54936 A (SIRRINGHAUS HENNING TESSLER NIR (GB); CAMBRIDGE DISPLA (GB); F) 28. Oktober 1999 (1999-16 Seite 6 das ganze Dokument	1-5					
P,X	US 2003/059987 A1 (SIRRINGHAUS HEI AL) 27. März 2003 (2003-03-27) Absatz '0101! das ganze Dokument	1-5					
Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen							
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung, die geelgnet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichung sdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung von beso							
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist							
Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts							
17. Mai 2004 27/05/2004							
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter					
	NL - 2280 HV Rijswijk Tet. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Bader, K	•				

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung

zur selben Patentfamilie gehören

tri atlonales Aktenzeichen
PC 03/03770

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19918193	Α	25-11-1999	DE GB JP	19918193 A1 2336553 A ,B 2000202357 A	25-11-1999 27-10-1999 25-07-2000
WO 9954936	A	28-10-1999	AU AU BR CA CN EP WO JP TW US	766162 B2 3614399 A 9909580 A 2328094 A1 1301400 T 1074048 A1 9954936 A1 2002512451 T 498395 B 6603139 B1	09-10-2003 08-11-1999 19-12-2000 28-10-1999 27-06-2001 07-02-2001 28-10-1999 23-04-2002 11-08-2002 05-08-2003
US 2003059987	Al	27-03-2003	AUU AUU BRR BRA A A A C C C C C C C C E E E E W W W J J J J U U U T U U T U U T U U T U U T U T	2015901 A 2016001 A 2206601 A 2206901 A 0016643 A 0016660 A 0016670 A 2394881 A1 2394895 A1 2394895 A1 2395004 A1 1425201 T 1425202 T 1425203 T 1425204 T 1243032 A2 1243033 A1 1243034 A1 1243035 A2 0147043 A1 0146987 A2 0147044 A2 0147045 A1 2003518332 T 2003518755 T 2003518756 T 2003059984 A1 2003059975 A1 2003059975 A1 2003060038 A1 552668 B	03-07-2001 03-07-2001 03-07-2001 03-07-2001 07-01-2003 25-02-2003 25-02-2003 24-06-2003 28-06-2001 28-06-2001 28-06-2003 18-06-2003 18-06-2003 25-09-2002 25-09-2002 25-09-2002 25-09-2002 25-09-2002 25-09-2002 25-09-2002 25-09-2002 25-09-2003 10-06-2003 10-06-2003 10-06-2003 10-06-2003 27-03-2003 27-03-2003 27-03-2003